

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成24年3月8日(2012.3.8)

【公表番号】特表2011-510145(P2011-510145A)

【公表日】平成23年3月31日(2011.3.31)

【年通号数】公開・登録公報2011-013

【出願番号】特願2010-543472(P2010-543472)

【国際特許分類】

C 0 8 J 7/04 (2006.01)

【F I】

C 0 8 J 7/04 F

C 0 8 J 7/04 L

【手続補正書】

【提出日】平成24年1月17日(2012.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 1 つの結合剤 C) 及び 1 つのホルムアルデヒド捕捉剤 D) で表面が被覆されており、少なくとも 1 つのポリオキシメチレンホモポリマー又はコポリマー A)、並びに場合により更なる添加剤 B) を含む、被覆ポリオキシメチレン成形品において、結合剤 C) として、ポリアルキレンオキシド C₁ 及び ポリビニルエステル C₂ からなるグラフトポリマー C₃ が使用され、かつホルムアルデヒド捕捉剤 D) として、少なくとも 1 つのヒドラジド化合物が使用されることを特徴とする、被覆ポリオキシメチレン成形品。

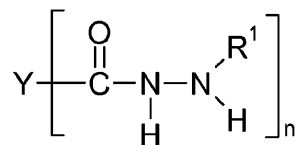
【請求項 2】

前記成形品が、チップ、ペレット、粉末、微粉末、ビーズ、レンズ状顆粒又はこれらの混合物からなることを特徴とする、請求項 1 に記載の POM 成形品。

【請求項 3】

ホルムアルデヒド捕捉剤 D) として、一般式

【化 1】



[式中、

n = 1 又は 2 であり、

R¹ = H 又は 5 ～ 6 個の炭素原子を有する芳香族残基であり、

Y = 2 ～ 30 個の炭素原子を有するアルキル残基又は 5 ～ 8 個の炭素原子を有する芳香族残基又はアミノ基若しくはヒドラジド基 (—NH—NH₂) であり、ここでアルキル残基又は芳香族残基は、場合により、酸素基、アミノ基、硫黄基、窒素基又はヒドラジド基を置換基として含むことができる]

のヒドラジド化合物が使用されることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の POM 成形品。

【請求項 4】

脂肪族若しくは芳香族ジヒドラジド D) 又はこれらの混合物が使用されることを特徴とする、請求項 1 から 3 までのいずれか 1 項に記載の POM 成形品。

【請求項 5】

結合剤 C₃ として、

A) 20～70 質量%の水溶性ポリエチレンオキシドと、

B) B1) 70～100 質量%の酢酸ビニル及び／又はプロピオン酸ビニル及び

B2) 0～30 質量%の更なるエチレン性不飽和モノマー

からなる 30～80 質量%のビニルエステル成分と

からなる構造を有する、C₁ と C₂ からなるグラフトポリマーが使用されることを特徴とする、請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項に記載の POM 成形品。

【請求項 6】

前もって成分 C) 及び D) から溶液、エマルジョン又は分散液を調製し、次にこれを POM 成形品に適用し、乾燥させることを特徴とする、請求項 1 から 5 までのいずれか 1 項に記載の被覆 POM 成形品の製造方法。

【請求項 7】

水性又はアセトン性溶液が C) 及び D) から調製されることを特徴とする、請求項 6 に記載の方法。

【請求項 8】

付加的に 10 質量%までの顔料 E) が、C) 及び D) からなる溶液に添加されることを特徴とする、請求項 6 又は 7 に記載の方法。

【請求項 9】

C) 及び D) からなる被覆が噴霧（スプレー）技術によって適用されることを特徴とする、請求項 6 から 8 までのいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 10】

被覆が室温から 60℃で適用されることを特徴とする、請求項 6 から 9 までのいずれか 1 項に記載の方法。